

КОНСТАНТЫ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГЛУБОКИХ АКЦЕПТОРОВ В МОДЕЛИ КОРОТКОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ЦЕНТРА

И. В. Костин, Е. Б. Осипов, Н. А. Осипова

Череповецкий государственный педагогический институт им. А. В. Луначарского, Череповец,
Россия

(Получена 5 апреля 1993 г. Принята к печати 25 мая 1993 г.)

Константы деформационного потенциала, определяющие расщепление вырожденных уровней глубоких акцепторов в условиях внешней деформации, рассчитаны в приближении короткодействующего потенциала центра. Использование разложения волновой функции примесного уровня по блоховским функциям идеального кристалла позволяет выразить примесные константы деформационного потенциала через зонные и через параметры зонной структуры (эффективные массы). Выполнены оценки для полупроводников с предельно малым ($\Delta = 0$) и большим спин-орбитальным расщеплением валентной зоны.

Константа изотропной деформации a_T для глубоких уровней отличается от зонной. При учете вклада в волновую функцию примесного уровня состояний валентной зоны и подмешивания состояний зоны проводимости отношение $a_T/a_V < 1$ зависит от параметров зонной структуры и уменьшается по мере углубления уровня в запрещенную зону. Сопоставление с известными значениями констант CuGa_3 , AgGa_3 , AuGa_3 в GaAs показало подтверждение этой закономерности.

Расщепление уровней основного состояния мелких акцепторов, имеющих симметрию вершины валентной зоны (Γ_8) при действии малой внешней деформации, описывается тремя константами деформационного потенциала a_T , b_T , d_T [¹]. Причем константа изотропной деформации a_T совпадает с зонной, а b_T и d_T рассчитываются в приближении эффективного гамильтонiana [¹] с использованием вариационных огибающих волновых функций.

Потенциал глубоких примесных центров резко отличается от кулоновского, характеризуясь мощной сердцевиной, которая формирует не водродоподобный характер поведения волновой функции, а приближающийся к модели потенциала нулевого радиуса. Это подтверждается оптическими измерениями спектральной зависимости сечения фотоионизации [², ³]. Поэтому влияние внешней деформации, затрагивающей протяженную часть волновой функции глубоких примесных состояний, представляется более адекватным рассчитывать в модели короткодействующего потенциала [³, ⁴] с учетом (в необходимых случаях) подмешивания других зон, нежели в кулоновской модели.

Рассмотрим вначале глубокие акцепторы, основной уровень которых имеет симметрию вершины валентной зоны [³], в предельных случаях слабого ($\Delta = 0$) и сильного ($\Delta \rightarrow \infty$) спин-орбитального расщепления валентной зоны.

Разложение волновой функции примесного уровня по блоховским функциям идеального кристалла имеет вид

$$\Psi_E^m = \sum_{\mu, n, k} \frac{\Psi_{\mu nk}(\mathbf{r})}{E - E_{nk}} \int \Psi_{\mu nk}^*(\mathbf{r}') V(\mathbf{r}') \Psi_E^m(\mathbf{r}') dr', \quad (1)$$

где $V(r')$ — потенциал центра, $\Psi_{\mu n k}$ и $E_{n k}$ — волновые функции и энергетический спектр в n -й зоне, m и μ нумеруют вырожденные состояния на центре и в зоне.

Считая потенциал центра короткодействующим и сферически симметричным и обозначая не зависящие от k отличные от нуля интегралы в (1) через постоянную A (определенную условием нормировки), получим коэффициенты разложения Ψ_E по блоховским функциям в явном виде. Блоховские функции записываются в виде разложения по базисным, соответствующим вершине валентной зоны. Внешняя деформации расщепляет вырожденные состояния центра и смещает их. Считая известными, например из эксперимента, константы, описывающие расщепление исходных базисных состояний экстремума валентной зоны, можно получить выражения для расщепления произвольных k -состояний в валентных подзонах [1]. А так как волновая функция примесного уровня (1) формируется именно этими состояниями, то соответственно можно выразить и константы, описывающие расщепления примесных состояний через исходные a, b, d .

В сферическом приближении для валентной зоны со слабым спин-орбитальным расщеплением $\Delta = 0$ для матричных элементов оператора одноосной деформации ($p \parallel z$), вычисленных на примесных функциях, получим

$$\begin{aligned} \langle X | \hat{H}(\varepsilon) | X \rangle &= \langle Y | \hat{H}(\varepsilon) | Y \rangle = -\frac{1}{2} \langle Z | \hat{H}(\varepsilon) | Z \rangle = \\ &= b\varepsilon_1 = b\varepsilon_1 |A|^2 \sum_k \left\{ \left[\frac{k^2 - k_x^2}{k^2(E - E_1(k))} + \frac{k_x^2}{k^2(E - E_2(k))} \right]^2 + \right. \\ &\quad \left. + \frac{k_z^2(k_x^2 + k_y^2)}{k^4} \left[\frac{1}{E - E_1(k)} - \frac{1}{E - E_2(k)} \right]^2 \right\}, \end{aligned} \quad (2)$$

где $E_1(k)$ и $E_2(k)$ — энергетический спектр в двухкратно и однократно вырожденной валентных подзонах, $\varepsilon_1 = \varepsilon_{zz} - \varepsilon_{xx}$ — относительная деформация вдоль оси z . Непосредственный расчет позволяет выразить отношение b_T/b через эффективные массы m_1 и m_2 дырок в валентной зоне

$$\frac{b_T}{b} = \frac{1}{5} \frac{7m_1^{3/2} + 2m_2^{3/2} + 12 \frac{m_1 m_2}{\sqrt{m_1} + \sqrt{m_2}}}{2m_1^{3/2} + m_2^{3/2}}. \quad (3)$$

В предельном случае $m_1 \gg m_2$ $b_T/b \rightarrow 0.7$, при $m_1 = m_2$ $b_T/b = 1$, что и следует ожидать для уровня, формируемого зонами с одинаковыми эффективными массами. Оценка отношения b_T/b для Si дает значения 0.80 для $m_1 = m_1$, $m_2 = m_h$ и 0.88 для $m_1 = m_h$, $m_2 = m_1$, которые несколько выше полученных для мелкого кулоновского акцептора [1] $b_T/b = 0.73$ и 0.84.

Для полупроводников с большим спин-орбитальным расщеплением валентной зоны Δ имеем

$$\frac{b_T}{b} = \frac{1}{5} \frac{\int_0^\infty k^2 dk \left\{ \frac{1}{(E - E_1)^2} + \frac{1}{(E - E_2)^2} + \frac{8}{(E - E_1)(E - E_2)} \right\}}{\int_0^\infty k^2 dk \left\{ \frac{1}{(E - E_1)^2} + \frac{1}{(E - E_2)^2} \right\}}. \quad (4)$$

При этом получим

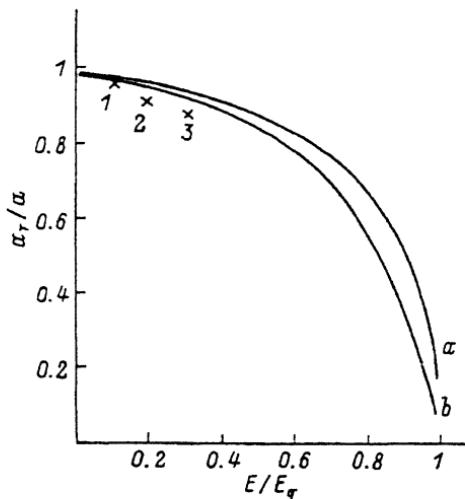


Рис. 1. Расчетная зависимость константы изотропной деформации a_T от энергии примесного уровня E для GaAs. Кривая a соответствует приближению $\Delta = 0$, b — приближению $\Delta \rightarrow \infty$. Точки — экспериментальные данные: 1 — CuGa, 2 — AgGa, 3 — Auga. Здесь E_g — ширина запрещенной зоны, a — зонная константа.

$$\frac{b_T}{b} = \frac{1}{5} \frac{m_1^{3/2} + m_2^{3/2} + 16 \frac{m_1 m_2}{\sqrt{m_1} + \sqrt{m_2}}}{m_1^{3/2} + m_2^{3/2}}. \quad (5)$$

Оценка b_T/b для Ge дает $b_T/b = 0.49$. Для GaAs $b_T/b = 0.57$, что согласуется со значениями для мелкого акцептора $b_T/b \sim 0.5 \div 0.6$ [5]. В сферическом приближении для валентной зоны отношения констант примесного центра к зонным, описывающим расщеплением уровней при $p \parallel [100]$ и $p \parallel [111]$, равны, т. е. $b_T/b = d_T/d$. Учет несферичности зон, выполненный в приближении $\Delta \rightarrow \infty$ для параметров Ge, дал результат $b_T/b = 0.41$, $d_T/d = 0.53$. Для GaAs $b_T/b = 0.52$, $d_T/d = 0.57$.

В приведенных расчетах константа a_T , описывающая сдвиг акцепторных уровней при изотропной деформации, равна зонной, так как не учитывался вклад в волновую функцию примесного уровня состояний других зон, в частности зоны проводимости. Этот вклад мал для уровней, близких к валентной зоне, однако, для глубоких уровней он становится заметным и должен приводить к отличию a_T от a , при этом и константы b_T и d_T зависят от положения уровня в запрещенной зоне. В данном случае для нахождения зонного спектра и коэффициентов разложения блоховских амплитуд по базисным использовалась модель Кейна, включающая в состав базисных функций не только состояния вершины валентной зоны, но и дна зоны проводимости. Ре-

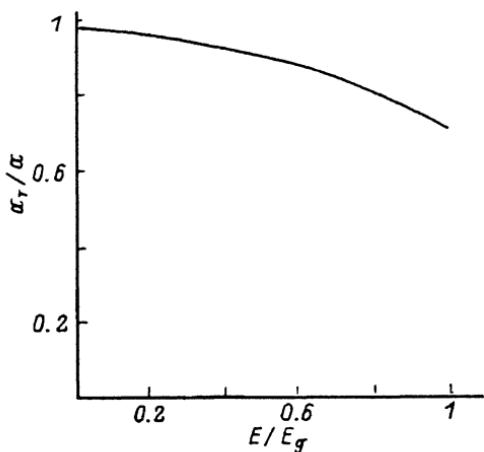


Рис. 2. Расчетная зависимость константы изотропной деформации a_T от энергии примесного уровня E для InSb в приближении $\Delta \rightarrow \infty$.

зультаты расчета константы a_T/a в приближении $\Delta=0$ и $\Delta \rightarrow \infty$ для полупроводников GaAs и InSb приведены на рис. 1, 2. Расчет показывает уменьшение константы a_T по мере углубления уровня в запрещенную зону, что подтверждается известными нам экспериментальными данными для глубоких акцепторов замещения Cu_{Ga}, Ag_{Ga}, Au_{Ga} в GaAs [^{6, 7}].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Г. Л. Бир, Г. Е. Пикус. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках, 584, М. (1972).
- [2] G. Lucovsky. Sol. St. Commun., 3, 299 (1965).
- [3] В. И. Перель, И. Н. Яссиевич. ЖЭТФ, 82, 237 (1982).
- [4] Е. В. Баханова. Тез. докл. 14-го Всес. (пекаровского) совещ. по теории полупроводников, 44 (1983).
- [5] R. N. Bhargava, M. I. Nathan. Phys. Rev., 161, 695 (1967).
- [6] Н. С. Аверкиев, З. А. Адамия, Д. И. Аладашвили, Т. К. Аширов, А. А. Гуткин, Е. Б. Осипов, Е. Б. Седов. ФТП, 21, 421 (1987).
- [7] M. E. Pistol, S. Nilsson, L. Samuelson. Phys. Rev. B, 38, 8293 (1988).

Редактор Т. А. Полянская
